DERWENT-ACC-NO:

1997-521112

DERWENT-WEEK:

200156

COLIKI

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Laser machining appts for laser drilling, laser cutting, marking of thin plate e.g. printed circuit board - has laser light scanning part which is input with second correction position command to scan irradiation position

of laser light

PATENT-ASSIGNEE: MITSUBISHI ELECTRIC CORP[MITQ] PRIORITY-DATA: 1996JP-0061043 (March 18, 1996)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO JP 09248688 A JP 3209078 B2 PUB-DATE September 22, 1997 September 17, 2001

LANGUAGE N/A N/A PAGES MAIN-IPC 012 B23K026/08 013 B23K026/08

APPLICATION-DATA: PUB-NO

PUB-NO APPI JP 09248688A N/A JP 3209078B2 N/A JP 3209078B2 Prev

APPL-DESCRIPTOR N/A N/A Previous Publ. 26/00, B23K026/04 APPL-NO 1996JP-0061043 1996JP-0061043 JP 9248688 APPL-DATE March 18,1996 March 18,1996 N/A

INT-CL (IPC): B23K026/00, B23K026/04, B23K026/08

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 09248688A

BASIC-ABSTRACT:

The appts has a laser oscillation part (3) which irradiates laser light to a processed object. A laser light scanning part (2) varies the track of irradiated laser light and scans the irradiation position of laser light. A laser light position command part (12) forms a position command of laser light scanning part. This position command is input to a first processed object correction part (13) which outputs a first correction position command to correct the spacing error of a processed object. A laser light scanning correction part (14) outputs a second correction position command to correct the spacing error of laser light scanning part, based on input of first correction position command. This second correction position command is input to laser light scanning part which scans the irradiation position of laser light.

ADVANTAGE - Forms position command without error. Performs highly precise laser machining, even when installation error of processed object is large. CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/11

TITLE-TERMS: LASER MACHINING APPARATUS LASER DRILL LASER CUT MARK THIN PLATE PRINT CIRCUIT BOARD LASER LIGHT SCAN PART INPUT SECOND CORRECT POSITION COMMAND SCAN IRRADIATE POSITION LASER LIGHT

DERWENT-CLASS: LO3 M23 P55 CPI-CODES: LO3-H04E9; M23-D05;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1997-165886 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1997-434137

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-248688

(43)公開日 平成9年(1997)9月22日

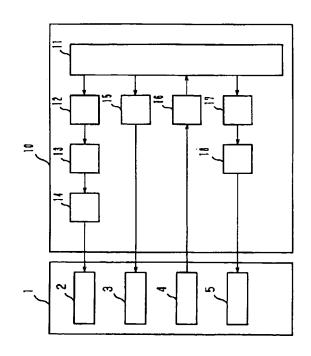
(51) Int.Cl. ⁸ B 2 3 K	26/08 26/00 26/04	識別記号	庁内整理番号	:	26/08 26/00 26/04		B M C	技術表示箇所
				審查請求	大蘭朱	請求項の数 9	OL	(全 12 頁)
(21)出顧番号	}	特願平8-61043		(71)出顧人)13 農株式会社		
(22)出願日		平成8年(1996)3	(72)発明者	東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 (72)発明者 高橋 悌史 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内				
				(72)発明者	東京都	詳人 F代田区丸の内 株式会社内	二丁目:	2番3号 三
,				(74)代理人	,弁理士	宮田 金雄	<i>(</i> \$134	<u>ຮ</u>)

(54) 【発明の名称】 レーザ加工装置

(57)【要約】

【課題】 従来のレーザ加工装置は、レーザ光走査系によるレーザ光の位置決め誤差を補正することは可能であるが、XYテーブル上に設置される被加工物の取り付け誤差によって発生するレーザ光の位置決め誤差を補正する機能がない。そのため、従来のレーザ加工装置は、被加工物をXYテーブル上に正確を位置合わせして取り付ける必要があり、被加工物を高精度に固定できる治具を用いなければならずコスト高となる。

【解決手段】 レーザ光走査系の位置指令を、被加工物の位置誤差を補正する第一の被加工物補正部で補正し、さらにレーザ光走査系の位置誤差を補正するレーザ光走査補正部で補正され、誤差の少ない位置指令を生成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ光を用いて被加工物を加工するレーザ加工装置において、レーザ光を前記被加工物に照射するレーザ発振部と、前記レーザ発振部で照射されるレーザ光の軌道を変化させてレーザ光の照射位置を走査するレーザ光走査部と、前記レーザ光走査部の位置指令を生成するレーザ光位置指令部と、前記位置指令を入力し、被加工物の位置誤差を補正する第1の補正位置指令を出力する第1の被加工物補正部と、前記第1の補正位置指令を入力し、レーザ光走査部の位置誤差を補正する 10第2の補正位置指令を出力するレーザ光走査部に入力してレーザ光の照射位置を走査することを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項2】 レーザ発振部から照射されるレーザ光の被加工物への照射位置を被加工物の位置を変化させて制御する被加工物位置制御部と、前記被加工物位置制御部の位置指令を生成する被加工物位置指令部と、前記被加工物位置指令部からの位置指令を入力し、前記被加工物の位置誤差を補正する第3の補正位置指令を出力する第20被加工物補正部と、前記第3の補正位置指令を前記被加工物位置制御部に入力して被加工物への照射位置を制御することを特徴とする請求項1記載のレーザ加工装置。

【請求項3】 被加工物の特徴位置を計測して出力する 特徴位置計測部を備え、前記特徴位置計測部の出力を前 記第1の被加工物補正部に入力して前記第1の補正位置 指令を出力することを特徴とする請求項1記載のレーザ 加工装置。

【請求項4】 被加工物の特徴位置を計測して出力する 30 特徴位置計測部を備え、前記特徴位置計測部の出力を前記第2の被加工物補正部に入力して前記第3の補正位置指令を出力することを特徴とする請求項2記載のレーザ加工装置。

【請求項5】 レーザ光を用いて被加工物を加工するレーザ加工装置において、レーザ光を前記被加工物に照射するレーザ発振部と、前記被加工物の特徴位置を計測して出力する特徴位置計測部と、前記被加工物に前記レーザ発振部からレーザ光を照射して作成したレーザ加工痕の位置情報を用いて前記計測情報の誤差を補正する計測 40 誤差補正部を備えたことを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項6】 レーザ発振部で照射されるレーザ光の軌道を変化させてレーザ光の照射位置を走査するレーザ光 走査部と、前記レーザ光走査部の位置指令を生成するレーザ光位置指令部を備え、前記レーザ加工痕は前記レーザ光走査部を走査領域の中心点付近で位置決めして作成したものを用いることを特徴とする請求項5記載のレーザ加工装置。

【請求項7】 レーザ光走査部の走査が静止したことを 判断するレーザ光走査静止判断部を備え、前記レーザ光 50 2

走査静止判断部の出力に基づいて前記レーザ発振部にレーザ発振指令を制御することを特徴とする請求項6記載のレーザ加工装置。

【請求項8】 レーザ光走査静止判断部は、前記レーザ光走査部の移動距離情報と、前記レーザ光走査部の移動 距離と静止時間との関係を示したデータと、前記静止時間を計測するタイマを用いて判断結果を出力することを 特徴とする請求項7記載のレーザ加工装置。

【請求項9】 レーザ発振部がレーザ光を照射し終わったことを判断するレーザ光発振終了判断部を備え、前記レーザ光発振終了判断部の出力に基づいて前記レーザ光位置指令部の位置指令を制御することを特徴とする請求項1記載のレーザ加工装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は高速高精度にレーザ 穴あけ加工、レーザ切断加工、マーキング等を行うレー ザ加工装置に関する。

[0002]

【従来の技術】プリント配線板のような薄板の穴あけ、 切断加工を行うレーザ加工機では、高速高精度にレーザ 光を走査し加工を行う必要がある。高速高精度にレーザ 光を走査するためにはガルバノメータビームスキャナを 用いてレーザ光を走査する方法が一般的である。このよ うなレーザ加工装置は、ビームスキャナによりレーザ光 を走査する高速なレーザ光走査系と、被加工物の設置台 を移動させるXYテーブル制御系の2つ位置制御系を併 用する場合が多い。レーザ光走査制御系は、ミラーを用 いてレーザ光を走査するので高速にレーザ光を走査をで きるが、ビームスキャナやレーザ光を集光、光路修正に 用いるレンズ特性のため非線形なビーム位置決め誤差が 発生する。また、ビームスキャナやレンズの取り付け誤 差でもレーザ光の位置決め誤差が発生する。また、被加 工物は前記テーブル制御系上に設置され、レーザ加工さ れるので、前記のレーザ光の位置決め誤差以外に被加工 物の取り付け誤差により、加工誤差を発生する。従来、 このようなレーザ加工装置では、校正用被加工物にレー ザ加工を行い、テレビカメラ等を用いた外部計測系によ り前記レーザ加工位置を計測し、レーザ光の位置決め誤 差を補正する特開平3-35892号公報に記載された レーザ加工装置のようなものがある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来のレーザ加工装置は、レーザ光走査系によるレーザ光の位置決め誤差を補正することは可能であるが、XYテーブル上に設置される被加工物の取り付け誤差によって発生するレーザ光の位置決め誤差を補正する機能がない。そのため、従来のレーザ加工装置は、被加工物をXYテーブル上に正確を位置合わせして取り付ける必要があり、被加工物を高精度に固定できる治具を用いなければならずコスト高とな

る。また、前記のような治具を用いても、治具の熱変形 や被加工物の変形により、取り付け誤差が発生し、高精 度なレーザ加工ができないという問題点があった。

【0004】本発明は、上述のような課題を解決するた めになされたもので、複雑な操作を必要とせず、高精度 なレーザ加工ができるレーザ加工装置を提供することを 目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明に係るレーザ加工 装置においては、レーザ光を前記被加工物に照射するレ 10 ーザ発振部と、前記レーザ発振部で照射されるレーザ光 の軌道を変化させてレーザ光の照射位置を走査するレー ザ光走査部と、前記レーザ光走査部の位置指令を生成す るレーザ光位置指令部と、前記位置指令を入力し、被加 工物の位置誤差を補正する第1の補正位置指令を出力す る第1の被加工物補正部と、前記第1の補正位置指令を 入力し、レーザ光走査部の位置誤差を補正する第2の補 正位置指令を出力するレーザ光走査補正部と、前記第2 の補正位置指令を前記レーザ光走査部に入力してレーザ 光の照射位置を走査するものである。

【0006】また、レーザ発振部から照射されるレーザ 光の被加工物への照射位置を被加工物の位置を変化させ て制御する被加工物位置制御部と、前記被加工物位置制 御部の位置指令を生成する被加工物位置指令部と、前記 被加工物位置指令部からの位置指令を入力し、前記被加 工物の位置誤差を補正する第3の補正位置指令を出力す る第2の被加工物補正部と、前記第3の補正位置指令を 前記被加工物位置制御部に入力して被加工物への照射位 置を制御するものである。

【0007】また、被加工物の特徴位置を計測して出力 30 する特徴位置計測部を備え、前記特徴位置計測部の出力 を前記第1の被加工物補正部に入力して前記第1の補正 位置指令を出力するものである。

【0008】また、被加工物の特徴位置を計測して出力 する特徴位置計測部を備え、前記特徴位置計測部の出力 を前記第2の被加工物補正部に入力して前記第3の補正 位置指令を出力するものである。

【0009】また、レーザ光を用いて被加工物を加工す るレーザ加工装置において、レーザ光を前記被加工物に 照射するレーザ発振部と、前記被加工物の特徴位置を計 40 測して出力する特徴位置計測部と、前記被加工物に前記 レーザ発振部からレーザ光を照射して作成したレーザ加 工痕の位置情報を用いて前記計測情報の誤差を補正する 計測誤差補正部を備えたものである。

【0010】また、レーザ発振部で照射されるレーザ光 の軌道を変化させてレーザ光の照射位置を走査するレー ザ光走査部と、前記レーザ光走査部の位置指令を生成す るレーザ光位置指令部を備え、前記レーザ加工痕は前記 レーザ光走査部を走査領域の中心点付近で位置決めをし て作成したものを用いるものである。この発明に係るレ 50

ーザ加工装置は、レーザ光走査部の走査が静止したこと

を判断するレーザ光走査静止判断部を備え、前記レーザ 光走査静止判断部の出力に基づいて前記レーザ発振部に レーザ発振指令を制御するものである。

【0011】また、レーザ光走査静止判断部は、前記レ ーザ光走査部の移動距離情報と、前記レーザ光走査部の 移動距離と静止時間との関係を示したデータと、前記静 止時間を計測するタイマを用いて判断結果を出力するも のである。

【0012】また、レーザ発振部がレーザ光を照射し終 わったことを判断するレーザ光発振終了判断部を備え、 前記レーザ光発振終了判断部の出力に基づいて前記レー ザ光位置指令部の位置指令を制御するものである。 [0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明をその発明の実施の 形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。

実施の形態1.図1は本発明の実施の形態1に係るレー ザ加工装置を示すブロック図である。図において、1は 本レーザ加工装置のレーザ機械制御部、2はガルバノビ ームスキャナ (以下、スキャナと略す) やミラー、レン ズ等から構成されるレーザ光を走査するレーザ光走査 部、3はレーザ発振器部、4はテレビカメラ等を用いて 被加工物の特徴点の位置を計測する特徴位置計測部、5 は被加工物を設置し位置決め制御するXYテーブル等か らなる被加工物位置制御部、10は本レーザ加工装置を 統括して制御するシステム制御部、11はプログラムを 解読してプログラムに従って処理を行い指令値を出力す るメイン制御部、12はメイン制御部11からレーザ光 走査部2の位置指令を入力記憶し、処理周期に応じて位 置指令を出力するレーザ光位置指令部、13は前記レー ザ光位置指令部から前記位置指令を入力し、被加工物の 取り付け誤差を補正する第1の補正位置指令を出力する 第1の被加工物補正部、14は前記第1の補正位置指令 を入力し、レーザ光走査部の取り付け誤差や光学特性に よる非線形特性を補正する第2の補正位置指令を出力す るレーザ光走査補正部である。前記第2の補正位置指令 はレーザ走査部2に入力される。15はメイン処理部か らのレーザ発振部3の制御指令を入力記憶し、レーザ発 振部3にレーザ発振のトリガ信号を出力するレーザ発振 指令部である。16は特徴位置計測部4から計測データ を入力し処理する計測処理部である。前記計測情報はメ イン処理部11に出力される。17は被加工物位置指令 部であり、メイン制御部11から被加工物位置制御部5 の位置指令を入力記憶し、処理周期に応じて位置指令を 出力する。18は前記位置指令を入力し前記被加工物の 取り付け誤差を補正する第3の補正位置指令を出力する 第2の被加工物補正部である。前記第3の補正位置指令 は、被加工物位置補正部5に入力される。上記システム 制御部10は、1つあるいは複数のCPU(中央処理装 置)、メモリ、入出力インターフェイス等で構成される

コンピュータシステムから成る。

【0014】図2は本発明の実施の形態1に係るレーザ 機械制御部を示す図である。図において、20はXYテ ーブル、21はXYテーブル20のX軸を駆動するモー タ、22はX軸のテーブルの位置を計測するエンコー ダ、23はY軸テーブルを駆動するモータ、24はY軸 のテーブル位置を計測するエンコーダ、25は被加工 物、26は被加工物25を設置するXYテーブル面、2 7はレーザ加工痕、28は被加工物25の位置合わせに 用いる基準点である。前記基準点28は通常、被加工物 10 25を作成するときに被加工物25上に取り付けられて いる。29はXYテーブル20の位置制御を行うテーブ ル制御装置であり、位置制御演算を行いモータ21、2 3を駆動する。テーブル制御装置29は前記第2の被加 工物補正部の前記第3の補正位置指令を入力し、前記位 置制御演算を行う。30はレーザ光、31はレーザ発振 器、32はレーザ発振器を制御する発振器制御部であ る。前記発振器制御部は前記レーザ発振指令部16から 発振指令を入力し指令に応じてレーザ光30を照射する ように働く。33はレーザ光30を反射するベンドミラ 20 ー、34はX軸方向にレーザ光を走査するガルバノメー タビームスキャナ (スキャナと略す)、35はX軸のミ ラー、36はY軸方向にレーザ光を走査するスキャナ、 37はY軸のミラー、38はレーザ光を集光、光路補正 を行うレンズ、39はスキャナ34、36の位置制御を 行うスキャナ制御装置である。前記スキャナ制御装置3 8は前記レーザ光走査補正部14の第2の補正位置指令 を入力し、レーザ光の走査、位置決め動作を行う。40 はテレビカメラ、41はテレビカメラ40で計測した画 像情報をパターンマッチング等の方法を用いて処理し、 画像中に含まれる特徴形状の2次元座標値を出力する画 像処理装置であり、ここでは被加工物25上の前記レー ザ加工痕27や前記基準点28の2次元座標を出力す る。前記画像処理装置41の出力は前記計測情報処理部 16へ出力される。43はレーザ光30の稼働範囲であ るレーザ走査領域である。レーザ光走査部2は、スキャ ナ34、36、ミラー35、37、レンズ38、ベンド ミラー33、スキャナ制御装置39の構成からなる。レ ーザ発振部3はレーザ発振器31および発振器制御部3*

*2の構成からなる。特徴位置計測部4はテレビカメラ1 8および画像処理装置19の構成からなる。また、被加 工物位置制御部5はXYテーブル20、モータ21、2 3、エンコーダ22、24、XYテーブル面26、テー ブル制御装置29の構成からなる。

【0015】次に本実施の形態1に係るレーザ加工装置 のレーザ光走査補正部の動作について説明する。レーザ 光走査部2は、スキャナ34、36の回転角を制御しX Yテーブル面26上にレーザ光30を走査、位置決めす るように働くが、通常、スキャナ、ミラー、レンズ等の 光学要素の取り付け誤差や非線形特性のために光学的誤 差が発生し(以下、レーザ光走査誤差と称す)、レーザ 光30の照射位置誤差が発生する。このレーザ光走査誤 差を補正するために、前記レーザ光走査補正部14は第 2の補正位置指令を出力し、前記光学要素誤差を除去す る。レーザ光走査補正部14の補正動作は、レーザ光走 査部2に入力される位置指令Xsc、Yscと、前記位置指令 でレーザ光30を照射したときの被加工物25上のレー ザ加工痕27の位置Xw、Ywの対応関係から補正量を求め る。前記Xsc、YscとXw、Ywの対応関係は、対応データ表 や座標変換式で表現され、これらによって補正量を計算 して行う。なお、前記加工痕27の位置は前記特徴位置 計測部4で計測される。

【0016】次に、第1および第2の被加工物補正部1 3、18の補正動作について説明する。レーザ光走査部 2が指令通りにレーザ光30を制御し、XYテーブル面 26上に正確に照射されたとしても、被加工物25がX Yテーブル面26の設置位置に正確に取り付けられてい なければ加工誤差を発生する。そこで、第1の被加工物 補正部13は、被加工物25の取り付け誤差を補正する ため、レーザ光位置指令部12から入力した位置指令を 前記被加工物25の取り付け誤差に応じて座標変換して 補正する。前記座標変換するためには被加工物25にあ らかじめ設置されている複数の基準点28の位置を特徴 位置計測部4で計測する。前記基準点28の計測した位 置をXm、Ymとし、被加工物25がXYテーブル面26に 正確に取り付けられた場合の前記基準点28の位置をX b、Ybとすると、以下の座標変換式を用いてこれらの関 係をあらわすことができる。

$$Xm=Pw1\cdot Xb + Pw2\cdot Yb + Pw3$$

(1)

 $Ym=Pw4 \cdot Xb + Pw5 \cdot Yb + Pw6$

(2)

ただし、Pw1、Pw2、Pw3、Pw4、Pw5、Pw6はパラメータで ある。前記パラメータは基準点28を被加工物25上に 3点以上設け、特徴点位置計測部4によって計測するこ とで求められる。そこで、第1の被加工物補正部13の※

※座標変換は、式1、2を用いて以下の計算を行う。レー ザ光位置指令部12から入力される位置指令をXsr、Ys r、出力をXsr1、Ysr1とすると、

 $Xsr1 = Pw1 \cdot Xsr + Pw2 \cdot Ysr + Pw3$

(3) $Ysr1 = Pw4 \cdot Xsr + Pw5 \cdot Ysr + Pw6$ (4)

となる。

【0017】また、第2の被加工物補正部18は、同様 に前記被加工物25の取り付け誤差を補正するため被加★50 正部18の補正計算式は、被加工物位置指令部17から

★工物位置指令部17から出力される位置指令を座標変換 して第3の補正位置指令を作成する。第2の被加工物補

出力される位置指令をX tr、Y trとし、座標変換した第 * 行われる。 3の補正位置指令をX tr1、Y tr1とすると以下の計算が*

 $Xtr1 = Pw1 \cdot Xtr + Pw2 \cdot Ytr + Pw3$ (5)

 $Ytr1 = Pw4 \cdot Xtr + Pw5 \cdot Ytr + Pw6$ (6)

前記の式3、4、5、6は被加工物25に取り付け誤差があった場合に、レーザ光走査部2か、被加工物位置制御部5かどちらか一方の動作で補正しようとするものであるが、第1および第2の被加工物補正部13、18を同時に作動させる場合もある。

【0018】以下に前記第1および第2の被加工物補正 10 部13、18を同時に作動させる場合の補正について説 明する。今、被加工物位置制御部5とレーザ光走査部2※

※の特質を比較すると、被加工物位置制御部5はストロークが長く、レーザ光走査部2はストロークが短いが高速にレーザ光を制御できるという特徴がある。そこでストロークの長い被加工物位置制御部5にオフセット分も含んだ座標変換式を用いるとレーザ光走査部のオフセットは0になり、有利な加工ができる。前記第2の被加工物補正部の座標変換式は、式7、8で表させ、

8

 $Xtr1 = Pw1 \cdot Xtr + Pw2 \cdot Ytr + Pw3$ (7)

 $Ytr1 = Pw4 \cdot Xtr + Pw5 \cdot Ytr + Pw6$ (8)

となるが、前記第2の被加工物補正部の座標変換式は式★ ★3、4、5、6より、

Xsr1 = Pw1 (Xsr - Xtr) + Pw2 (Ysr - Ytr) (9)

Ysr1 = Pw4 (Xsr - Xtr) + Pw5 (Ysr - Ytr) (10)

となる。なお、式7、8、9、10のパラメータPw1、P & w2、Pw3、Pw4、Pw5、Pw6は図2の被加工物25上の基準点28を3点以上持っており、前記基準点28を前記特 20 徴位置計測部4で位置計測することで求めることができる。なお、式1~10の座標変換式は、6個のパラメータPw1、Pw2、Pw3、Pw4、Pw5、Pw6を用いる方法であるが、被加工物の取り付け誤差が、オフセットと回転ずれの場合はPw4=-Pw2、Pw5=Pw1となり、被加工物25の基準点は2点以上必要となる。

【0019】図1のシステム制御部10の動作を図3に 従って説明する。図3は本発明の実施の形態1に係るシ ステム制御部の動作を示すフローチャートである。ステ ップS1では特徴位置計測部4の計測情報と被加工物位 30 置制御部5の位置情報を入力して前記基準点28の位置 を計算する。ステップS2では前記基準点28の位置計 測値から第1の被加工物補正部13と、第2の被加工物 補正部18の前記パラメータを計算する。ステップS3 では、加工プログラムを読み出し、レーザ光走査部2の 位置指令と被加工物位置制御部5の位置指令を求める。 ステップS4では、前記位置指令を第1および第2の被 加工物補正部13、18の補正演算を行い、前記第1の 補正位置指令と第3の補正位置指令を計算する。ステッ プS5では、前記第1の補正位置指令をレーザ光走査補 40 正部の補正演算を行い、前記第2の補正位置指令を計算 する。ステップS6では、前記第2の補正位置指令をレ ーザ光走査部2に出力し、前記第3の補正位置指令は被 加工物位置制御部5に出力される。ステップS7では、 レーザ発振指令をレーザ発振器部にレーザ発振トリガ信 号を出力し、被加工物25の指令位置を加工する。以上 のように第1と第2の被加工物補正部13、18とレー ザ光走査補正部14があるので、被加工物に取り付け誤 差があっても良好なレーザ加工が実現できる。

【0020】実施の形態2.図4は本発明の実施の形態☆50 のような座標変換式で関係づけられる。

☆2に係るシステム制御部のブロック図である。図におい て、1~18は実施の形態1を示す図1の構成と同じで ある。60は本レーザ加工装置を統括して制御するシス テム制御部、61はプログラムを解読し、プログラムに 従って処理を行い指令値を出力するメイン制御部、62 は特徴位置計測部4から得られる計測情報を補正する計 測誤差補正部である。システム制御部60が図1のシス テム制御部10と異なるのは、計測誤差補正部62を備 える点とメイン制御部61の処理内容が図1メイン制御 部11の処理内容と一部異なる点である。メイン制御部 61が前記メイン制御部11と異なる点は計測誤差補正 部62に入力する補正データを作成する処理を行ってい る点が異なる。図5は本発明の実施の形態2に係るテレ ビカメラに取付け誤差がある場合を示す図であり、詳し くは、特徴位置計測部4に用いられる図2のテレビカメ ラ40に取り付け誤差がある場合を示している。図にお いて、70はテレビカメラ40が正確に取り付けられて いる場合の特徴位置計測部4の計測領域、71はテレビ カメラ40に取り付け誤差がある場合の計測領域であ る。図6は本発明の実施の形態2に係るシステム制御部 の計測誤差補正部の計測補正用パラメータを求める動作 を示すフローチャートである。

【0021】次に、動作について説明する。図5のように、計測領域が70である場合が、テレビカメラ40が正確に取り付けられている場合とすると、テレビカメラ40に取り付け誤差があると計測領域が71となり、特徴位置計測部4は計測誤差を発生する。この計測誤差を補正するには、計測領域71から70への座標変換を行えばよい。たとえば、テレビカメラ40が正確に取り付けられている場合の特徴位置計測部4の出力がXv1、Yv1とし、テレビカメラ40に取り付け誤差がある場合の特徴位置計測部4の出力をXv、Yvとすると、例えば、以下のような座標で増出で関係ではよった。

Xv1=Pv1·Xv + Pv1·Yv + Pv3 Yv1=Pv4·Xv + Pv5·Yv + Pv6

(11) (12)

10

ここで、Pv1、Pv2、Pv3、Pv4、Pv5、Pv6は計測補正用のパラメータである。計測誤差補正部では式11、12の計算が行われ、特徴位置計測部4の計測情報が補正される。前記計測誤差補正用パラメータは特徴位置計測部4を用いてXYテーブル座標上の既知の位置を3点以上計測させることで求められる。本実施の形態2では、前記既知の位置はXYテーブル上に設置されている被加工物25上に作成する校正用レーザ加工痕を用いる。

【0022】前記計測補正用パラメータを求める動作に ついて、図6に従って説明する。S10では、レーザ光 30がレーザ光走査領域42の中心位置に照射されるよ うに図2のレーザ光走査部2のスキャナ12、14の位 置決めを行い、被加工物25上にレーザ光30を照射し 前記校正用加工痕を作成する。前記中心位置を用いるの は、レンズ38のレンズ歪みの影響がもっとも小さくレ ーザ加工痕の形状も点形状に最も近くなり特徴位置計測 部4の計測精度が高くなるからである。S11では、被 加工物位置制御部5を移動させ、前記校正用レーザ加工 20 痕をテレビカメラ40の視野内に移動し、前記視野内で 異なる3点の位置を特徴位置計測部4で計測する。S1 2では、特徴位置計測部4の前記視野内の3点の位置計 測情報と、テレビカメラが正しく取り付けられていた場 合の前記3点の位置情報から計測誤差補正部62で用い る計測誤差補正用パラメータを計算し、計測誤差補正部 62の補正計算に用いる。上述のように、レーザ加工痕 を用いて特徴位置計測部の取り付け誤差の校正を行うの で、新たに校正用のマークを作成したりする手間が省 け、高精度な計測が可能となり、ひいてはレーザ加工の 30 高精度化が実現できる。

【0023】なお、レーザ光走査領域42の中心位置に 複数個の校正用レーザ加工痕を作成するとさらに高速に 計測誤差補正部62の前記計測補正用のパラメータが求 められることはいうまでもない。

【0024】実施の形態3.図7は本発明のの実施の形態3に係るレーザ光走査部のレーザ加工装置を説明するための図である。図において、1~18は実施の形態1を示す図1の構成と同じである。80は本レーザ加工装置を統括して制御するシステム制御部、81はプログラ 40ムを解読し、プログラムに従って処理を行い指令値を出力するメイン制御部、82はレーザ光走査部2の移動距離と静止時間の関係が記述されているデータ表、83はレーザ光走査部2が静止したかどうかを判断するレーザ光走査静止判断部、84はレーザ光走査静止判断部83のタイマ、85はレーザ発振部3のレーザ光の発振が終了したかどうかを判断するレーザ発振終了判断部、86は前記レーザ発振終了判断部85のタイマである。システム制御部80は、図1のシステム制御部10と異なるところは、前記82~85の処理部と、図1のメイン制*50

* 御部11がメイン制御部81に変更されている点である。メイン制御部81は図1のメイン制御部の処理内容に加えて、レーザ光走査静止判断部83、レーザ発振終了判断部85の判断結果を用いて位置指令の出力、レーザ発振指令の出力を行う。図8は本発明の実施の形態3に係るレーザ光走査部の位置指令に対する時間応答の様子を示す図である。図8(a)は移動距離が短いD1の場10合であり、このときの静止時間はTs1である。図8

(b) は移動距離が長いD2の場合であり、このときの静止時間はTs2である。図9は本発明の実施の形態3に係るデータを説明するための図であり、各移動距離に対する静止時間をあらかじめ測定しておく。なお、このデータはレーザ光走査部2の移動速度をスキャナ34、36の最高速度で移動した場合の静止時間で計測する。図10は本発明の実施の形態3に係るレーザ出力の時間応答を示す図であり、レーザ発振部3にレーザ発振指令が入力されたときを示している。なお、レーザ光発振時間はTbである。図11は本発明の実施の形態3に係るレーザ加工装置の動作を表すフローチャートである。

【0025】次に動作について説明する。 プリント配線 板等の穴あけ加工を行う場合、多数のランダムに並んだ 穴位置にレーザ光走査部2を位置決めしてレーザ加工を 行う。このようなレーザ加工ではレーザ光走査部2が静 止している状態でレーザ加工を行わないとレーザ光が指 令位置に照射される加工精度が劣化するという問題が生 じる。また、レーザ発振部3がレーザ光を照射している 状態で、レーザ光走査部2を移動させると、同様にレー ザ加工精度が悪くなる。そこで、本実施の形態3のレー ザ加工装置では高精度な加工を実現するために、図7の ようにレーザ光走査静止判断部83とレーザ光発振終了 判断部85を用いる構成をとる。 図8のレーザ光走査部 2の静止時間はレーザ光走査部2が指令位置に達する時 間と目標位置に達してからの振動の整定時間の和とな る。前記レーザ光走査静止判断部83は、指令位置の移 動距離により前記静止時間を推定する。前記移動距離と 静止時間の関係はあらかじめ計測して図9のごとくデー タ表を持っているので前記推定はテーブルルックアップ 方式で簡単に求められる。また、レーザ光走査静止判断 部83はタイマ84をもっているので、前記レーザ走査 部の静止したか否かを判断することができる。判断結果 は、メイン処理部81に出力する。また、前記レーザ光 発振終了判断部85は、発振図10のレーザ発振時間も 通常レーザ加工条件で変化するので、加工条件 (レーザ ピーク出力とレーザパルス幅等) ごとに前記レーザ発振 時間も計測してデータ表として持つ。ただ、本実施の形 態3ではレーザ発振部の加工条件を変化させないので前 記レーザ発振時間はTb1つの値を持つ。

【0026】図11のフローチャートを用いて複数の穴

加工を行う場合の本レーザ加工装置の動作について説明 する。ステップS1、ステップS2は実施の形態1の図 3と同じ処理を行う。ステップS20は加工プログラム より被加工物位置制御部17の位置指令を読み込み、被 加工物位置指令部17に格納する、ステップS21は第 2の被加工物補正部18の補正計算を行う。ステップS 22では第3の補正位置指令を被加工物位置制御部5に 出力し、被加工物位置制御部の位置決め動作を行う。ス*

求める移動距離Dcは、前記Dx、Dyの値の大きい方を選 ぶ。

【0027】次に、前記Dc とデータ表82を用いて直 線補間式によりレーザ光走査静止時間を求める。例え ※

$$Ts = Dc \cdot (Ts2 - Ts1) / (D2 - D1)$$
 (15)

ステップS25ではレーザ位置指令部17の位置指令か ら第1の被加工物補正部18の補正計算を行い、第1の 補正位置指令を求める。また、前記第1の補正位置指令 からレーザ光走査補正部14の補正計算を行い、第2の 補正位置指令を求める。ステップS26では前記第2の 20 補正位置指令をレーザ光走査部2に出力する。ここでレ ーザ光走査部2は第2の補正位置指令に従って位置制御 が開始される。ステップS27では、前記レーザ光走査 静止判断部83のタイマ84が起動され時間計測が開始 される。ステップS28はレーザ光走査部2の静止判断 を行う処理で、前記タイマ84の時間計測値が前記光走 査静止時間Ts より小さければ前記レーザ光走査部は静 止していないと判断しNへ、大きければ静止が完了した と判断しYへ分岐する。ステップS29ではレーザ発振 指令部15からレーザ発振部3にレーザ発振指令である 30 トリガ信号を出力する。ステップ30では前記トリガ信 号を入力してレーザ発振終了判断部85のタイマ86が 起動され時間計測が開始する。 ステップ S31では、レ ーザ発振部3の発振終了判断を行う処理で、前記タイマ 86の時間計測値が前記レーザ光発振時間Tbより小さけ れば前記レーザ発振は終了してしていないと判断しN へ、大きければ前記レーザ発振は終了したと判断しYへ 分岐する。S32では加工終了か否かを判断する。加工 終了でない場合はYに分岐しステップS22の処理に戻 り、次の穴加工を行う。加工終了なら、処理を終わる。 上述のように動作するのでレーザ光走査部2が確実に静 止している状態でレーザ光が発振されるので、加工誤差 の少ないレーザ加工が実現できる。また、レーザ発振部 のレーザ発振が確実に停止してから、レーザ光走査部が

[0028]

る.

【発明の効果】本発明は、以上説明したように構成され ているので、以下に示すような効果を奏する。

移動するので加工誤差の少ないレーザ加工が実現でき

* テップS23では加工プログラムからレーザ光走査部2 の位置指令を読みだし、レーザ光位置指令部12に格納 する。ステップS24では前記位置指令から前記時間を 求める処理を行う。レーザ光走査静止判断部では、レー ザ光走査静止時間を求めるために以下の処理を行う。前 記位置指令をXc、Ycとし、前回にレーザ光位置指令部 1 2に格納された位置指令をXcd、Ycdとすると、以下の計 算により移動距離Dcを求める。

12

(13)

(14)

※ば、前記Dc が図9のデータ表で、D1 <Dc < D2 の範</p> 囲ならば、求めるレーザ光走査静止時間Ts は下式で求 められる。

★工物補正部と、レーザ光走査補正部を備えているので、 被加工物の取り付け誤差が大きい場合でも、高精度なレ ーザ加工ができる。

【0030】また、被加工物の位置誤差を補正する第2 の被加工物補正部を備えているので、被加工物の取り付 け誤差が大きい場合でも、高精度なレーザ加工ができ る。

【0031】また、第1の被加工物補正部は特徴位置計 測部で被加工物の特徴位置を計測した結果を用いて補正 を行うので、被加工物の取り付け誤差が大きい場合で も、高精度なレーザ加工ができる。

【0032】また、第2の被加工物補正部は特徴位置計 測部で被加工物の特徴位置を計測した結果を用いて補正 を行うので、被加工物の取り付け誤差が大きい場合で も、高精度なレーザ加工ができる。

【0033】また、特徴位置計測部に取り付け誤差があ ってもレーザ加工痕の位置情報を用いて計測情報の誤差 を補正する計測誤差補正部を備えているので、被加工物 の取り付け誤差が大きい場合でも高精度なレーザ加工が できる。

【0034】また、特徴位置計測部に取り付け誤差があ っても、レーザ光走査部の走査領域の中心点付近で位置 決めをして作成したレーザ加工痕の位置情報を用いて計 測情報の誤差を補正する計測誤差補正部を備えているの で、被加工物の取り付け誤差が大きい場合でも高精度な レーザ加工ができる。

【0035】また、レーザ光走査静止判断部の出力に基 づいてレーザ発振指令を出力するので、レーザ光走査部 が移動中にレーザ加工されることがなく、高精度なレー ザ加工ができる。

【0036】また、レーザ光走査部の移動距離情報と、 レーザ光走査部の移動距離と静止時間との関係を示した データと、タイマを用いてレーザ光走査部の静止判断を 行った結果を用いてレーザ発振指令を出力するので、レ 【0.029】被加工物の位置誤差を補正する第1の被加★50 ーザ光走査部が移動中にレーザ加工されることがなく高

40

精度なレーザ加工ができる。

【0037】また、レーザ発振部がレーザ光を照射し終わったことを判断するレーザ光発振終了判断部を備え、この出力に基づいてレーザ走査部の位置指令を出力するので、レーザ発振中にレーザ光走査が移動することがなく、高精度なレーザ加工ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の形態1に係るレーザ加工装置を示すブロック図である。

【図2】 本発明の実施の形態1に係るレーザ機械制御 10 部を示す図である。

【図3】 本発明の実施の形態1に係るシステム制御部の動作を示すフローチャートである。

【図4】 本発明の実施の形態2に係るシステム制御部のブロック図である。

【図5】 本発明の実施の形態2に係るテレビカメラに 取付け誤差がある場合を示す図である。

【図6】 本発明の実施の形態2に係るシステム制御部の計測誤差補正部の計測補正用パラメータを求める動作を示すフローチャートである。

14

【図7】 本発明の実施の形態3に係るレーザ光走査部のレーザ加工装置を説明するための図である。

【図8】 本発明の実施の形態3に係るレーザ光走査部 の位置指令に対する時間応答の様子を示す図である。

【図9】 本発明の実施の形態3に係るデータを説明するための図である。

【図10】 本発明の実施の形態3に係るレーザ出力の時間応答を示す図である。

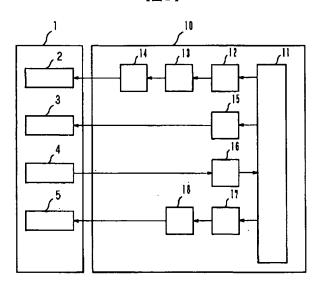
【図11】 本発明の実施の形態3に係るレーザ加工装置の動作を表すフローチャートである。

【符号の説明】

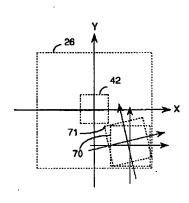
2 レーザ光走査部、3 レーザ発振部、4 特徴位置計測部、5 被加工物位置制御部、12 レーザ光位置指令部、13 第1の被加工物補正部、14レーザ光走査補正部、17 被加工物位置指令部、18 第2の被加工物補正部、27レーザ加工痕、62 計測誤差補正部、83 レーザ光走査静止判断部、82 テータ表、84 タイマ、85 レーザ光発振終了判断部、86タイマ。

20

【図1】



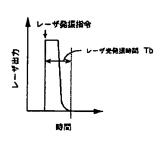
【図5】

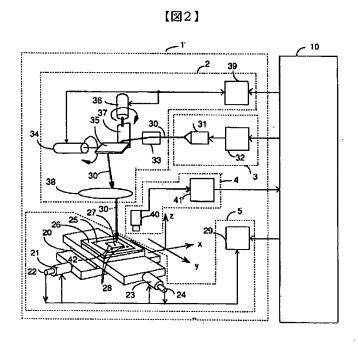


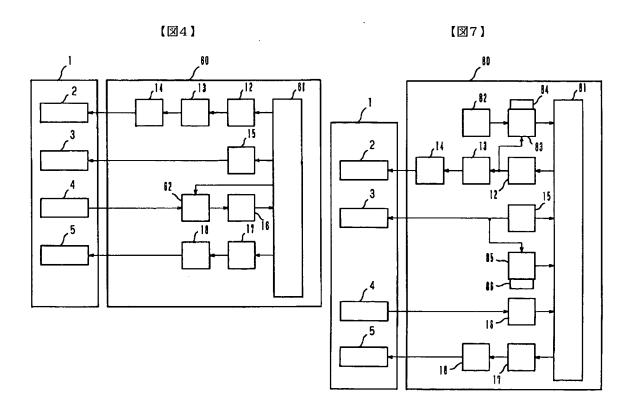
【図9】

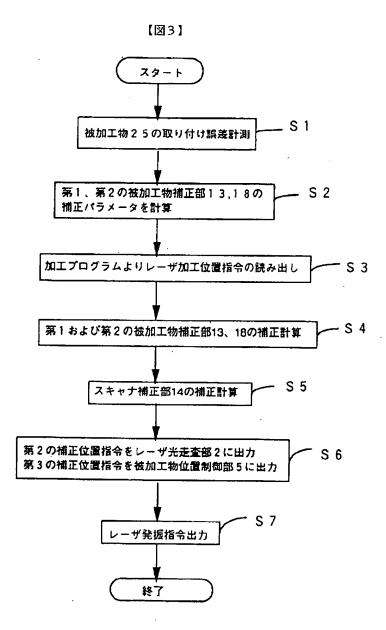
移動距離	静止時間			
D 1	Ts1			
D2	Ts2			
D3	Т3			
:	:			
Dn	Tn			

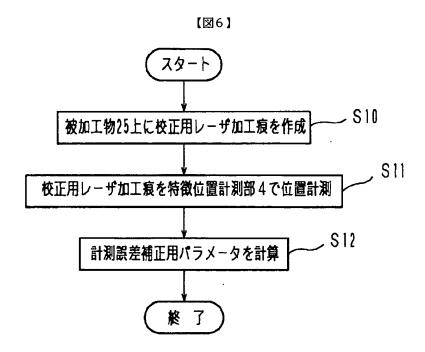
【図10】



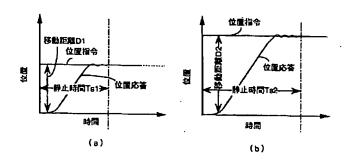








【図8】



【図11】

